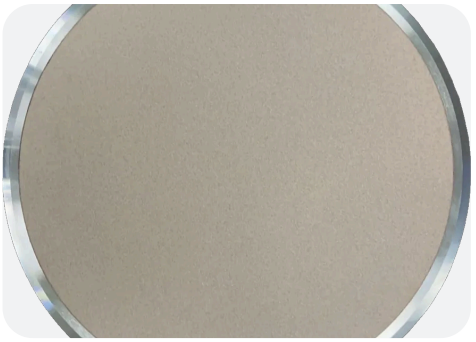
CHUCK TABLE

晶圓用 Chuck table

Wafer Chuck Table

晶圓用 Chuck table 是清洗、切割、研磨晶圓時固定晶圓的晶圓真空吸盤（wafer chuck），以多孔陶瓷面均勻吸住晶圓。尺寸有 6、8、12 吋，可再研磨，也提供翻修與換陶。



孔徑 Pore size	平面度（6 / 8 吋） Flatness	尺寸 Dimension
50 ~ 100 μm	< 3 μm	6 / 8 / 12 吋

FEATURES

產品特點

再研磨與重複使用 Reusable
經再研磨後可反覆使用。

耐磨耗 Wear-resistant
具陶瓷堅硬的特性，本身耐損耗。

靜電與潔淨 Static dissipative
表面阻抗 10^6 ~ 10^9 Ω，屬靜電消散；陶瓷完全燒結，不發塵。

輕量結構 Lightweight
內部結構為均勻氣孔，重量減輕。

價格親民
價格親民、成本低廉；可再研磨反覆使用，並提供翻修與換陶。

SPECIFICATION

產品規格

孔徑 Pore size	50 ~ 100 μm
孔隙率 Porosity	40 ~ 60%
平面度 Flatness	6 吋 / 8 吋 < 3 μm；12 吋 < 5 μm
尺寸 Dimension	6 吋 / 8 吋 / 12 吋

底座材質 Base material	以金屬及氧化鋁材質為主，客製化 / 洽詢
顏色 Color	黑 / 土黃 / 灰
表面阻抗 Surface resistance	10^6 ~ 10^9 Ω（靜電消散）

實際規格以報價圖面為準。

APPLICATIONS

應用範圍

清洗
作為清洗盤，以真空吸住晶圓固定。

切割
作為切割盤，以真空吸住晶圓固定。

研磨
作為研磨盤，以真空吸住晶圓固定。

應用領域：半導體、LED 封測、印刷。

服務項目

翻修　換陶　新品製作

CUSTOM PATTERNS

客製化吸附圖案

吸附區可依工件客製，圖案可做圓孔、條紋或不規則形狀。
方形 Chuck table 需採金屬材質製作，歡迎洽詢。

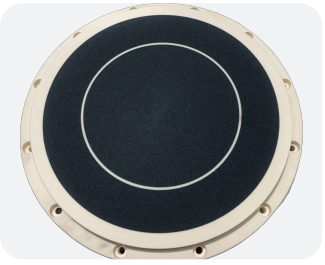
COMPARISON

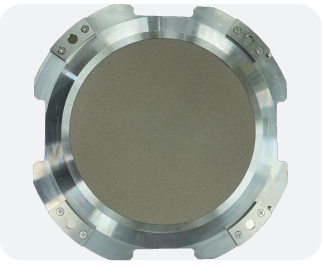
與傳統金屬吸盤比較

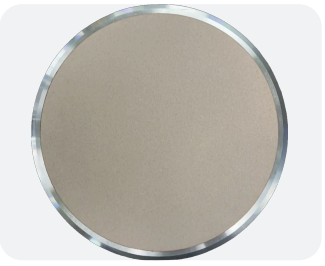
項目	多孔陶瓷 Chuck table	傳統金屬吸盤
功能性	多孔陶瓷表面均勻吸附。	吸附較小工件時需封堵未覆蓋的孔。
對工作物影響	多孔陶瓷吸附可減少薄工件因吸力產生的形變。	吸力可能使薄工件凹陷、變形。
平面精度	6 / 8 吋 <3 μm；12 吋 <5 μm。	精度受環境溫度影響較大。
靜電問題	表面阻抗 10^6 ~ 10^9 Ω，屬靜電消散材質。	靜電累積可能造成工件損傷。

PHOTOS

產品照片


研磨盤


金屬框 Chuck table (附定位塊)


多孔陶瓷面


金屬框 Chuck table (附固定扣)

官網產品頁有介紹影片與可旋轉的 3D 剖視圖：www.sawa-corp.com/products/wafer-chuck/

告訴我們吋別與需求，我們回報價。

03-5501300
vic@sawa-corp.com